Сверхбыстрые вибронные фазовые переходы в полупроводниках под действием фемтосекундных лазерных импульсов

© В.И. Емельянов, Д.В. Бабак

Международный Лазерный Центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 119899 Москва, Россия

(Поступила в Редакцию 4 сентября 1998 г. В окончательной редакции 24 декабря 1998 г.)

Произведен учет межмодового ангармонического взаимодействия в теории сверхбыстрых ($t \sim 10^{-13}$ s) вибронных фазовых переходов на поверхности полупроводников (Si, GaAs) под действием фемтосекундных лазерных импульсов. Получены условия плазменно-индуцированных переходов либо в состояние хаотической разупорядоченности положений атомов ("холодной жидкости"), либо в состояние с отличной от исходной кристаллической симметрией кристалла (новой кристаллической фазы). Показано, что в GaAs в случае перехода второго типа реализуется структура типа NaCl, причем этот переход обусловлен неустойчивостью ветви продольных оптических фононов. Сделаны соответствующие численные оценки для Si и GaAs.

Начиная с 80-х годов различными группами изучается эффект сверхбыстрого (на временах порядка 10^{-13} s, меньших времени передачи энергии из электронной подсистемы в решетку au_{e-ph}) изменения симметрии поверхности кристаллических полупроводников под действием фемтосекундных лазерных импульсов, генерирующих плотную электрон-дырочную (э-д) плазму. Такие сверхбыстрые лазерно-индуцированные фазовые переходы (ЛИФП) экспериментально изучались структурночувствительным методом регистрации отраженных первой и второй гармоник (ВГ) в Si [1-3], в GaAs [4-10] и в InSb [7]. Недавние эксперименты [9] в GaAs свидетельствуют о сверхбыстром схлопывании запрещенной зоны и переходе в металлическую фазу; при этом сигнал ВГ исчезает на временах порядка сотен фемтосекунд, что свидетельствует о переходе GaAs в центросимметричное состояние [10].

Существуют две основные точки зрения на механизм сверхбыстрых структурных ЛИФП. В модели "холодной жидкости" (ХЖ) сверхбыстрое изменение симметрии кристалла в приповерхностном слое связывается с появлением разупорядочения положений атомов [1–3], которое можно трактовать как следствие неустойчивости континуума фононных мод. В модели новой кристаллической фазы (НКФ) результаты экспериментов [4] по фемтосекундному ЛИФП в GaAs трактуются с точки зрения плазменно-индуцированной неустойчивости одной фононной моды, приводящей к переходу в новое кристаллическое (центросимметричное) состояние [11–13].

В теоретических работах [14-17] в качестве механизмов сверхбыстрого ЛИПФ в полупроводниках рассмотрена неустойчивость поперечных акустических фононных мод. В данной работе будет показано, что сверхбыстрые структурные ЛИФП в полупроводниках могут быть связаны с неустойчивостью оптических фононных мод. Это объясняется следующими обстоятельствами.

Расчет свободной энергии как функции деформации и концентрации э-д плазмы [18] показал, что при ла-

зерном возбуждении в GaAs наиболее вероятен переход в центросимметричную металлическую структуру типа NaCl, как наиболее близкую по энергии к исходной фазе цинковой обманки. Фазовый переход из структуры цинковой обманки GaAs в структуру типа NaCl происходит в результате сдвига подрешеток Ga и As относительно друг друга вдоль вектора $\tau = 0.25s[111]b$ (τ — вектор, направленный по диагонали гранецентрированной кубической ячейки, b — длина диагонали [19], s — параметр). При s = 1 получается нецентросимметричная структура GaAs, при s = 2 центросимметричная структура типа NaCl.

Относительные смещения двух подрешеток атомных плоскостей Ga и As вдоль направления вектора τ соответствуют ветви продольных оптических (*LO*) фононов с **q** = 0. Таким образом, фазовый переход GaAs в структуру типа NaCl следует связать с плазменно-индуцированной неустойчивостью одной *LO* фононной моды с *q* = 0, $\Omega_0 = 5.3 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$ в центре зоны Бриллюэна. Аналогичный вывод может быть сделан и для случая Si.

В настоящей работе построена теория плазменно-индуцированной неустойчивости ветви *LO* мод. Проведен учет межмодового фонон-фононного взаимодействия, приводящего к сверхбыстрой трансформации структуры кристалла, описываемой временной эволюцией спектральной функции относительных атомных смещений. Показано, что в зависимости от условий облучения и характеристик кристалла возможен переход либо в состояние XЖ, либо в состояние НКФ. Определены условия реализации каждого из этих состояний и проведена интерпретация экспериментов по индуцированию сверхбыстрых структурных ЛИФП в Si [1–3] и GaAs [4,8–10].

В отсутствие лазерной накачки результаты данной теории согласуются с результатами равновесной вибронной теории сегнетоэлектричества [20].

Замкнутая система уравнений вибронной модели кристалла в лазерном поле

Рассмотрение плазменно-индуцированной неустойчивости *LO* мод в GaAs и Si проведем на основе вибронной модели, предложенной в равновесной теории сегнетоэлектричества [20] и использованной в теории лазерноиндуцированных фазовых переходов [21].

В простейшей ("молекулярной") модели ковалентный кристалл представляется как система двухатомных молекул в элементарных ячейках [22]. Электронный спектр в такой модели состоит из двух (вырожденных) уровней с верхним уровнем *a*, соответствующим зоне проводимости, и нижним уровнем *b*, соответствующим валентной зоне. Частота перехода между уровнями $\omega_{ab} = E_g/\hbar$, где E_g — ширина запрещенной зоны.

Уравнения для Фурье-амплитуды *LO* фононной моды $u_0 \equiv u_{q=0}$ с учетом взаимодействия с электронной подсистемой имеет вид (см. [21])

$$\frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2} + \tilde{\omega}_0^2 u_0 = \frac{1}{\mu} |\theta| \Delta \rho_{aa} - \frac{1}{\mu} (\theta_{ab} \rho_{ba} + \theta_{ba} \rho_{ab}), \quad (1)$$

где $\tilde{\omega}_0$ — частота предельного оптического фонона без учета электрон-фононного ангармонизма, μ — приведенная масса ячейки, $\theta_{ab} = \theta_{ba}$ — недиагональные матричные элементы оптического потенциала деформации, $|\theta| = |\theta_{aa} - \theta_{bb}|, \theta_{bb} > \theta_{aa} > 0, \rho_{aa}, \rho_{ab}$ — диагональные и недиагональные элементы электронной матрицы плотности ($\rho_{ab} = \rho_{ba}$), $\Delta \rho_{aa} = \rho_{aa} - \rho_{aa}^0 \approx \rho_{aa}$ изменение диагонального элемента матрицы плотности при лазерном возбуждении (ρ_{aa}^0 — равновесное значение диагонального элемента). Из (1) следует, что в равновесии ($\frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2} = 0$) в отсутствие лазерной накачки ($\rho_{ab} = \rho_{ba} = 0, \ \Delta \rho_{aa} = 0$) $u_0 = 0$, что соответствует исходной, нецентросимметричной диэлектрической фазе GaAs.

Уравнение для низкочастотного недиагонального элемента электронной матрицы плотности $\rho_{aa} \sim \exp(-i\tilde{\omega}_0 t)$ имеет вид [21]

$$\frac{\partial \rho_{ab}}{\partial t} + i\omega_{ab}\rho_{ab} = \frac{i|\theta|u_0\rho_{ab}}{\hbar} + \frac{i\theta_{ab}u_0D_{ab}}{\hbar} - \frac{iC\xi_L\rho_{ab}}{\hbar}.$$
 (2)

Здесь $D_{ab} = \rho_{aa} - \rho_{bb} < 0$, $C = C_{aa} - C_{bb}$, где C_{aa}, C_{bb} — матричные элементы акустического потенциала деформации, $\boldsymbol{\xi}_L = \text{div } \mathbf{u}_L$ — лазерно-индуцированная деформация среды, \mathbf{u}_L — вектор смещения среды, индуцированного действием лазерного излучения.

Уравнение для концентрации электронов проводимости n_e имеет вид

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = -\frac{n_e}{\tau} - \gamma_A n_e^3 + D_e \frac{\partial^2 n_e}{\partial z^2} + \frac{\alpha c E^2 (1-R)}{2\pi \hbar \omega} \exp(-\alpha z), \qquad (3)$$

где α (cm⁻¹) и R — соответственно коэффициенты оптического поглощения и отражения; ω, E — частота

Физика твердого тела, 1999, том 41, вып. 8

и амплитуда лазерного поля на поверхности z = 0, γ_A — постоянная Оже-рекомбинации, c — скорость света в вакууме, τ — время линейной рекомбинации, D_e — коэффициент амбиполярной диффузии носителей по направлению нормали к поверхности.

Для получения зависимости α от u_0 запишем уравнение для высокочастотной части недиагонального элемента матрицы плотности $\rho_{ab}^{(\omega)} \sim \exp(i\omega t)$

$$\frac{\partial \rho_{ab}^{\omega}}{\partial t} + i \left(\omega_{ab} - \frac{|\theta| u_0}{\hbar} + \frac{C\xi_L}{\hbar} \right) \rho_{ab}^{\omega} + \gamma_{ab} \rho_{ab}^{\omega}$$
$$= -\frac{i d_{ab} D_{ab}}{\hbar} E \exp\left(-\frac{\alpha z}{2}\right), \quad (4)$$

где d_{ab} — недиагональный матричный элемент дипольного момента, γ_{ab} — константа релаксации недиагонального элемента матрицы плотности. При учете зависимости электронной матрицы плотности от квазиимпульса из (4) можно получить выражение для коэффициента оптического поглощения двухзонного полупроводника в общем виде

$$\alpha = \alpha(\hbar\omega - E_{g0} - C\xi_L + |\theta|u_0)$$

$$\approx \alpha_0 + \alpha' \frac{|\theta| u_0}{\hbar} + \frac{1}{2} \alpha'' \left(\frac{\theta u_0}{\hbar}\right)^2.$$
 (5)

Для рассматриваемого случая прямозонного полупроводника

$$\alpha_0 = \text{const} \cdot \sqrt{\hbar\omega - E_g}, \quad \alpha' = \frac{\partial \alpha}{\partial \omega}, \quad \alpha'' = \frac{\partial^2 \alpha}{\partial \omega^2}.$$
(6)

Уравнения (1)–(3), (5) составляют замкнутую систему вибронных уравнений кристалла в лазерном поле.

Лазерно-индуцированное размягчение ветви продольных оптических фононов и вибронный фазовый переход

Из (5) видно, что при $\Phi\Pi$ с возникновением статического смещения $u_0 > 0$, без учета влияния лазерноиндуцированной деформации

$$E_{g\ eff} = E_{g0} - |\theta|u_0,\tag{7}$$

где в нестационарном переходном режиме $u_0 \sim \exp(\gamma_0 t)$ (см. [17]).

Из (7) следует, что $u_0 = E_g/|\theta| = b/4$ соответствует центросимметричной металлической фазе со структурой NaCl ($E_g \ eff = 0$).

Пренебрегая в (3) диффузией и линейной рекомбинацией ($\gamma_A n_e^2 \gg \tau_p^{-1}$), получаем с учетом (5) для концентрации плазмы на поверхности z = 0

$$n_{e} = \sqrt[3]{\frac{\alpha c E^{2}(1-R)}{2\pi\hbar\omega\gamma_{A}}} \approx n_{e0} \left[1 + \frac{1}{3}\frac{\alpha'}{\alpha_{0}}\frac{|\theta|u_{0}}{\hbar} + \left(\frac{1}{6}\frac{\alpha''}{\alpha_{0}} - \frac{2}{9}\frac{(\alpha')^{2}}{(\alpha_{0})^{2}}\right)\left(\frac{|\theta|u_{0}}{\hbar}\right)^{2}\right], \quad (8)$$

где

$$n_{e0} = \sqrt[3]{\frac{\alpha_0 c E^2 (1-R)}{2\pi \hbar \omega \gamma_A}}.$$
(9)

Используя (3), (8) и (6), выражаем приращение диагонального элемента матрицы плотности $\rho_{aa} = n_e/n$ через u_0 ; из (2) выражаем ρ_{ab} . Подставляя полученные выражения в (1), получаем замкнутое нелинейное уравнение для фурье-амплитуды предельной оптической моды с q = 0

$$\frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2} + \omega_0^2 u_0 = -|\Gamma_A| u_0^2. \tag{10}$$

Здесь перенормированная частота мягкого LO фонона

$$\omega_0^2 = \tilde{\omega}_0^2 \left(1 - \frac{2|D_{ab}|\theta_{ab}^2}{E_{g0}\mu\tilde{\omega}_0^2} - k_1\xi_L - k_2n_{e0} \right), \tag{11}$$

где

$$k_1 = rac{2 heta_{ab}^2 C |D_{ab}|}{E_{g0}^2 \mu \tilde{\omega}_0^2}, \quad k_2 = rac{| heta|^2}{6\mu n \tilde{\omega}_0^2 (\hbar \omega - E_{g0})}$$

Константа электрон-решеточного ангармонизма

$$\Gamma_A = -\left\{\frac{2\theta_{ab}^2|\theta||D_{ab}|}{\mu E_{g0}^2} + \frac{7|\theta|^3 n_{e0}}{72\mu n(\hbar\omega - E_g)^2}\right\}.$$

В отсутствие лазерной накачки ($n_{e0} = 0$, $\xi_L = 0$) выражение (11) совпадает с известной формулой для частоты мягкого оптического фонона, получаемой в равновесной вибронной теории сегнетоэлектричества [20]. Равновесный фазовый переход в кристаллическую фазу с новой симметрией происходит благодаря занулению эффективной частоты оптического фонона при критической температуре T_{cr} , определяемой из уравнения th $\frac{E_{g0}}{2k_BT_{cr}} = \frac{E_{g0}\mu\omega_0^2}{2\theta_{ab}^2}$, которое следует из (11) при $\omega_0^2 = 0$ и совпадает с соответствующим уравнением [20]. Два дополнительных члена в (11) учитывают влияние концентрации неравновесной э–д плазмы n_{e0} и лазерноиндуцированной деформации ξ_L . Для области, где деформация размягчает частоту фонона ($C\xi_L > 0$), имеем из (11) для квадрата частоты мягкого оптического фонона

$$\omega_0^2 = \Omega_0^2 (1 - |\sigma \xi_L|) \left(1 - \frac{n_{e0}}{n_{cr}} \right).$$
(12)

Здесь квадрат частоты предельного оптического фонона в основном электронном состоянии ($|D_{ab}| = 1$) с учетом влияния э-ф ангармонизма

$$\Omega_0^2 = \tilde{\omega}_0^2 \left(1 - \frac{2\theta_{ab}^2 |D_{ab}|}{E_{g0}\mu \tilde{\omega}_0^2} \right), \quad \sigma = \frac{2\theta_{ab}^2 C |D_{ab}|}{E_{g0}^2 \mu \Omega_0^2}$$
(13)

и критическая концентрация э-д плазмы, при которой происходит зануление частоты оптического фонона

$$n_{cr} = (1 - |\sigma\xi_L|)n_{cr1},$$
 (14)

где критическая концентрация э–д плазмы в отсутствие деформации ($\xi_L = 0$) $n_{cr1} = 6n\mu\Omega_0^2(\hbar\omega - E_{g0})|\theta|^{-2}$.

Размягчение частоты предельного оптического фонона $(\omega_0 \rightarrow 0)$ приводит к размягчению всей ветви *LO* фононов в окрестности q = 0, где частоты фононов ω_q задаются формулой

$$\omega_q = \omega_0 (1 - \beta q^2), \tag{15}$$

 ω_0 задается формулой (12) и $\beta > 0$ — константа, которую можно определить из фононной дисперсионной кривой *LO* фонона по формуле

$$\beta = -\frac{1}{2\omega_0} \frac{\partial^2 \omega_q}{\partial q^2} \Big|_{q=0} \,. \tag{16}$$

Формула (15) получается из простейшей модели решетки в виде одномерной системы упруго связанных атомных плоскостей Au и Ga.

Как следует из (15) и (12), при $n_{e0} > n_{cr}$ частоты оптических фононов в окрестности q = 0 становятся мнимыми

$$\omega_q = \pm i\gamma_q, \quad \omega_0 = \pm i\gamma_0; \quad \gamma_q = \gamma_0 - \beta\gamma_0 q^2, \qquad (17)$$

где γ_q и γ_0 — действительные величины, а фононные моды превращаются в неустойчивые моды относительных атомных смещений вдоль направления вектора τ .

Перейдем теперь к нахождению спектральной функции атомных смещений.

3. Кинетическое уравнение для спектральной функции относительных атомных смещений

Гамильтониан системы фононов с учетом ангармонического взаимодействия оптических и акустических фононов имеет вид

$$H = H_0 + H_{unh} = \sum_q \hbar \omega_q \left(b_q^+ b_q + \frac{1}{2} \right)$$

+ $\sum_{q_1q_2} V_{q_1q_2} (b_{q_1}a_{q_2}b_{q_1+q_2}^+ + b_{-q_1-q_2}a_{-q_2}^+ b_{-q_1}^+).$ (18)

Здесь

$$V_{q_1q_2} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{\hbar^3}{8M\mu^2 N^3}} N^{-1/2} \\ \times \frac{\sum_{n_1,n_2} \mathbf{f}_{n_1n_2} \exp\{i(\mathbf{q}_1 \mathbf{r}_{n_1} + \mathbf{q}_2 \mathbf{r}_{n_2})\}}{\sqrt{\omega_{q_1} \Omega_{q_2} \omega_{-q_1-q_2}}},$$
(19)

N — число атомов в кристалле; M — масса ячейки, $\Omega_e = qs$ — частота акустического фонона, s — скорость звука, a_q , a^+_{-q} и b_q , b^+_{-q} — операторы уничтожения и порождения соответственно акустических и оптических фононов, \mathbf{r}_k — равновесный радиус-вектор k-й ячейки

$$\mathbf{f}_{k,l,m} = \left[\frac{\partial^3 \Phi}{\partial \mathbf{r}_k \partial \mathbf{r}_l \partial \mathbf{r}_m}\right]_{U_l=0}, \quad i=k,l,m,$$

где Ф — энергия межатомного взаимодействия всего кристалла.

Определим спектральную функцию относительных атомных смещений по формуле

$$S(q) = \frac{\hbar}{\mu\omega_q} n_q, \quad n_q = \langle b_q^+ b_q \rangle.$$
 (20)

Используя уравнения Гейзенберга для операторов устойчивых акустических и неустойчивых оптических мод, следующих из (18), получим уравнение для n(q)

$$\frac{\partial n_q}{\partial t} = 2\gamma_q n_q - \frac{i}{\hbar} \sum_{q_1} \left\{ V_{q_1,q-q_1} \langle b_q^+ b_{q_1} a_{q-q_1} \rangle - V_{-q_1,-q+q_1} \langle b_q b_{q_1}^+ a_{q-q_1}^+ \rangle \right\}.$$
(21)

Из уравнений для b_q , b_q^+ и a_q^+ , вводя в последнее константу затухания устойчивых акустических мод δ_q и учитывая, что акустические фононы сильно демпфированы ($\delta_q \gg \Omega_q, \gamma_q$), получаем для коррелятора $\langle b_q^+ b_{q_1} a_{q-q_1} \rangle$ выражение:

$$\langle b_q^+ b_{q_1} a_{q-q_1} \rangle = rac{i}{\hbar} \sum_{q_1} rac{V_{-q_1,-q+q_1}}{\delta_{q-q_1}} n_{q_1} N_{q-q_1},$$

где $N_{q-q_1} = \left(\exp\left(\frac{\hbar\Omega_{q-q_1}}{k_BT}\right) - 1\right)^{-1}$ — числа заполнения акустической фононной моды $q - q_1$. Аналогичное выражение получается и для коррелятора $\langle b_q b_{q_1}^+ a_{q-q_1}^+ \rangle$.

Тогда с учетом определения (20) имеем из (21) искомое кинетическое уравнение для спектральной функции атомных смещений

$$\frac{\partial S(q)}{\partial t} = (\gamma_q + \gamma_{q_1})S(q) + \frac{2}{\hbar^2} \sum_{q_1} \frac{V^2}{\delta_{q-q_1}} \frac{\omega_{q_1}}{\omega_q} N_{q-q_q} S(q_1).$$
(22)

Выражение для константы ангармонического взаимодействия V^2 , следующее из (19) при условии $n_{e0} > n_{cr}$, имеет вид

$$V^{2} \equiv V_{q_{1},q-q_{1}}V_{-q_{1},-q+q_{1}} = -\frac{1}{288}\frac{\hbar^{3}}{NM\mu^{2}}\frac{|f^{2}|}{\Omega_{q-q_{1}}\gamma_{q}^{2}} < 0,$$
$$|f|^{2} \approx g^{2}\left(\frac{W}{a^{3}}\right)^{2}, \qquad (23)$$

где g > 1 — число ближайших соседей, W — энергия межатомного взаимодействия в ячейке. При выводе (23) использовано, что при $n_{e0} > n_{cr}$ с учетом (17) имеет место равенство $(\omega_{q_1}\omega_{-q_1}\omega_q\omega_{-q})^{-1/2} \approx -\gamma_q^{-2}$.

Диффузионный коллапс спектральной функции относительных атомных смещений

Для константы затухания устойчивых акустических фононных мод в (22) можно получить следующее выражение:

$$\delta_{q-q_1} = |q - q_1|b, \tag{24}$$

где $b = \frac{2\pi\theta C_{ab}^2 n_e^*}{\hbar \gamma_{ab} M_s} \frac{n_e^*}{n}$, n_e^* — эффективная концентрация электронов проводимости в вырожденном полупроводнике, принимающих участие в поглощении фононов.

Физика твердого тела, 1999, том 41, вып. 8

9

Полагая в (22) $\gamma_{q_1} \approx \gamma_q$ и переходя от суммирования к интегрированию, с учетом (23) и (24) получаем линейное интегральное уравнение для спектральной функции

$$\frac{\partial S(q)}{\partial t} = 2\gamma_q S(q) - |A| \int_{-\infty}^{+\infty} dq_1 K(|q-q_1|) S(q_1), \quad (25)$$

где

$$|A| = rac{1}{576\pi^2} \, rac{n}{n_e^*} \, rac{\gamma_{ab}}{\gamma_0^2} \, rac{\hbar^2 |f|^2}{\mu^2 heta_{ab}^2} a, \quad K(|q-q_1|) = rac{N_{q-q_1}}{|q-q_1|^2}.$$

Делая замену переменных $q_1 = q - \xi$ и раскладывая функцию $S(q_1)$ в подынтегральном выражении в (25) в ряд Тейлора по ξ , из (25) получаем уравнение диффузии для спектральной функции атомных смещений в q-пространстве с отрицательным коэффициентом диффузии D

$$\frac{\partial S(q)}{\partial t} = 2\gamma_q S(q) - |D| \frac{\partial^2 S}{\partial q^2},\tag{26}$$

где модуль коэффициента спектральной диффузии

$$|D| = \frac{|A|}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi K(|\xi|) \xi^2 \equiv \frac{A}{2} \frac{2kT}{\hbar s} \int_{x_m}^{\infty} \frac{dx}{e^x - 1}.$$

Здесь нижний предел интегрирования определяется неопределенностью значения $|\boldsymbol{\xi}| = |\mathbf{q} - \mathbf{q}_1|$ (векторы \mathbf{q}, \mathbf{q}_1 направлены вдоль [111]): $x_m = (\hbar s/kT) \min |\boldsymbol{\xi}| = (\hbar s/kT) 2\pi \alpha$, где α — коэффициент оптического поглощения.

Тогда коэффициент спектральной диффузии

$$|D| = \frac{\hbar}{576\pi^2} \frac{n}{n_e^*} \frac{\gamma_{ab}}{\Omega_0^2} \frac{k_B T}{a^5 \mu^2 s} g^2 \times \left(\frac{W}{C_{ab}}\right)^2 \left(\frac{n_{e0}}{n_{cr}} - 1\right)^{-1} \ln\left(\frac{2\pi\alpha\hbar s}{kT}\right).$$
(27)

Будем считать, что в начальный момент (при t = 0) $S(q, 0) = S_0 = \text{const.}$ Тогда решение уравнения (26) для неравновесной спектральной функции относительных атомных смещений имеет вид

$$S(q,t) = S_0 \frac{\exp(2\gamma_0 t)}{\sqrt{1 - 8\beta\gamma_0 |D| t^2}} \exp\left(-\frac{q^2}{\frac{1}{4\beta\gamma_0 t} - 2|D| t}\right).$$
 (28)

Введем характерное время схлопывания спектра по формуле

$$t_m = \frac{1}{\sqrt{8|D|\beta\gamma_0}}.$$
 (29)

Как видно из (28), на временах $0 < t < t_m$ спектральная функция S(q, t) испытывает эволюцию от равномерного начального распределения к гауссовому распределению с растущим во времени максимумом в центре зоны Бриллюэна q = 0 и уменьшающейся во времени шириной. В момент $t = t_m$ спектральная функция оптических атомных смещений схлопывается в δ -функцию: $S(q, t_m) \sim \delta(q)$.

При выполнении условия

$$t_m < (2\gamma_0)^{-1} < \tau_{cr} \sim \tau_P, \tag{30}$$

где τ_{cr} — время, в течение которого концентрация плазмы n_{e0} превосходит критическое значение n_{cr} , амплитуды мод за время τ_P успевают нарасти, а их спектр схлопывается в δ -функцию при q = 0. Таким образом, в случае (30) за время τ_P решетка переходит в состояние с полностью скоррелированным когерентным относительным смещением атомов во всех ячейках кристалла, т.е. в состояние НКФ.

С другой стороны, при условии

$$(2\gamma_0)^{-1} \ll t_m, \quad (2\gamma_0)^{-1} < \tau_{cr} \sim \tau_P$$
 (31)

за время τ_P нарастает широкий спектр мод, который благодаря нелинейности стабилизируется и становится плоским. Таким образом, в случае (31) происходит переход в состояние ХЖ.

Сделаем численные оценки для случаев ЛИФП в GaAs и Si. Из (14) и (13) для GaAs при $\mu = 6 \cdot 10^{-23}$ g, $\Omega_0 = 5.3 \cdot 10^{13} \, {\rm s}^{-1}$, $\omega = 3 \cdot 10^{15} \, {\rm s}^{-1}$, $E_{g0} = 1.44 \, {\rm eV}$, $|\theta| \sim 10^{-3} \, {\rm erg/cm}$, $n = 2 \cdot 10^{22} \, {\rm cm}^{-3}$, $\theta_{ab} = 2.1 \cdot 10^{-4} {\rm erg} \cdot {\rm cm}^{-1}$ и $|C| = 20 \, {\rm eV}$ [23] и оценочном значении $\xi_L = 0.25$ [24] имеем для критической концентрации плазмы: $n_{cr} = 3 \cdot 10^{21} \, {\rm cm}^{-3}$. В условиях эксперимента [4] при $E^2 = 4 \cdot 10^9 \, {\rm erg} \cdot {\rm cm}^{-3}$, R = 0.35; $\gamma_A = 4 \cdot 10^{-28} \, {\rm cm}^{6} {\rm s}^{-1}$ [23], учитывая нелинейное увеличение коэффициента оптического поглощения $\alpha_0 \sim 10^2 \, {\rm a}_0 = 4.3 \cdot 10^6 \, {\rm cm}^{-1}$, из (9) получаем оценку для концентрации плазмы $n_{e0} \sim 3.5 \cdot 10^{21} \, {\rm cm}^{-3} > n_{cr}$.

Из (12) и (17) находим $\gamma_0 = 10^{13} \,\mathrm{s}^{-1}$. Используя данные из [23], имеем с учетом (16) $\beta \gamma_0 \sim 10^{-1} \,\mathrm{cm}^2 \mathrm{s}^{-1}$. Используя в (27) и (29) значения $W = 3.1 \cdot 10^{-11} \,\mathrm{erg}$, g = 4, $T = 300 \,\mathrm{K}$, $s = 5 \cdot 10^5 \,\mathrm{cm/s}$, $a = 3.6 \cdot 10^{-8} \,\mathrm{cm}$, $n/n_e^* \sim 2 \cdot 10^2$, $\gamma_{ab} \sim 10 \cdot \Omega_0$, $C_{ab} \sim 1 \,\mathrm{eV}$ [23] и полученные выше значения n_{e0} и n_{cr} , получаем оценки для коэффициента спектральной диффузии в GaAs $|D| = 5 \cdot 10^{26} \,\mathrm{cm}^{-2} \mathrm{s}^{-1}$ и для времени схлопывания спектра: $t_m = 48 \,\mathrm{fs} < (2\gamma_0)^{-1} \sim 50 \,\mathrm{fs} < \tau_{cr} \sim \tau_P$. Таким образом, для GaAs выполняются условия перехода в состояние НКФ (30).

Теперь сделаем аналогичные оценки для Si. При тех же значениях ω , E^2 , T и при $\alpha_0 \sim 10^2 \bar{\alpha}_0 = 4.5 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-1}$, R = 0.35; $\gamma_A = 4 \cdot 10^{-31} \text{ cm}^6 \text{s}^{-1}$, $C_{ab} \sim 1 \text{ eV}$ [23] из (9) получаем $n_{e0} \sim 1.7 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$. Подставляя в (27) и (29) $n_{cr} = 9 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ [16], $\mu = 2.4 \cdot 10^{-23}$ g, $W = 2.88 \cdot 10^{-12}$ erg, g = 4, $\Omega_0 = 1.1 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$, $s = 10^6 \text{ cm/s}$, $a = 3.4 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$, $n/n_e^* \sim 2 \cdot 10^2$, $\gamma_{ab} \sim 10 \cdot \Omega_0$ [23], $\gamma_0 = 5 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, $\beta\gamma_0 \sim 10^{-1} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$, получаем оценки для коэффициента спектральной диффузии в Si $|D| = 2.2 \cdot 10^{24} \text{ cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ и времени "схлопывания" спектра: $t_m = 756 \text{ fs} \gg (2\gamma_0)^{-1} = 10 \text{ fs}$, $\tau_{cr} \sim \tau_P \gg (2\gamma_0)^{-1}$. Таким образом, для Si с большим запасом выполняются условия перехода в состояние ХЖ (31).

Таким образом, проведенное в настоящей работе рассмотрение показывает, что при сверхбыстрых ЛИФП в GaAs наиболее вероятен переход в состояние НКФ, в то время как в Si реализуется переход в состояние XЖ.

Список литературы

- C.V. Shank, R. Yen, C. Hirlimann. Phys. Rev. Lett. 50, 454 (1983).
- [2] C.V. Shank, R. Yen, C. Hirlimann. Phys. Rev. Lett. 54, 2151 (1985).
- [3] H.W.K. Tom, G.D. Aumiller, C.H. Brito-Cruz. Phys. Rev. Lett. 60, 1438 (1988).
- [4] С.В. Говорков, И.Л. Шумай, В. Рудольф, У. Шредер. Письма в ЖЭТФ 52, 2, 755 (1990).
- [5] K. Sokolovski-Tinten, H. Schulz, J. Bialkowski, D. von der Linde. Appl. Phys. 53, 227 (1991).
- [6] K. Sokolovski-Tinten, J. Bialkowski, D. von der Linde. Phys. Rev. B51, 20, 14186 (1995).
- [7] I.L. Shumay, V. Hofer. Phys. Rev. B53, 23, 15878 (1996).
- [8] Y. Siegal, E.N. Glezer, E. Mazur. Phys. Rev. B49, 23, 16403 (1994).
- [9] E.N. Glezer, Y. Siegal, L. Huang, E. Mazur. Phys. Rev. B51, 11, 6959 (1995).
- [10] E.N. Glezer, Y. Siegal, L. Huang, E. Mazur. Phys. Rev. B51, 15, 9589 (1995).
- [11] S.V. Govorkov, V.I. Emel'yznov, N.I. Koroteev, I.L. Shumay. J. of Luminescence 53, 153 (1992).
- [12] С.В. Говорков, В.И. Емельянов, И.Л. Шумай, В. Рудольф, Т. Шредер. ИРАН 56, 6, 64 (1992).
- [13] S.V. Govorkov, V.I. Emel'yanov, I.L. Shumay. Laser Physics 2, 1, 77 (1992).
- [14] V. Heine, J.A. Van Vechten. Phys. Rev. B13, 4, 1622 (1976).
- [15] R. Biswas, V. Ambegaokar. Phys. Rev. B26, 1982 (1982).
- [16] P. Stampfli, K.H. Bennemann. Phys. Rev. B42, 7163 (1990); *ibid.* Phys. Rev. B49, 11, 7299 (1994).
- [17] V.I. Emel'yanov, D.V. Babak. Laser Phys. 7, 2, 514 (1997).
- [18] Ю.В. Копаев, В.В. Меняйленко, С.Н. Молотков. ФТТ 27, 11, 3288 (1985).
- [19] Toshinobu Soma. J. Phys. C: Solid State Phys. 11, 2681 (1978).
- [20] N. Kristoffel, P. Konsin. Phys. Stat. Sol. 21, 39 (1967); 28, 731 (1968).
- [21] A.V. Andreev, V.I. Emel'yanov, Yu.A. Il'inskii. Cooperative effects in optics: Superradiance and phase transitions. Adam Hilger, Bristol (1993).
- [22] M. Lannoo, J. Bourgoin. Point Defects in Semiconductors I. Springer Verlag, Berlin (1981).
- [23] Landolt-Bornstein. Numerical data and functional relatinships in science and technology. New series. Group III. V. 17. Semiconductors. Subvolume *a*. Phys. of group IV elements and III–V compounds.
- [24] В.И. Емельянов, И.Ф. Уварова. ЖЭТФ 94, 255 (1988); Laser Physics 2, 4, 389 (1992).